※誠に恐れ入りますが、貴部署にて掲示または回覧していただけますと幸甚です。

第30回分析電子顕微鏡討論会のお知らせ

主催：公益社団法人　日本顕微鏡学会　分析電子顕微鏡分科会　（責任者：ルネサスエレクトロニクス(株) 朝山匡一郎）

協賛：日本物理学会、応用物理学会、日本表面科学会、日本金属学会、日本鉄鋼協会、日本分析化学会、

　　　日本セラミックス協会、日本材料学会、触媒学会、軽金属学会、日本熱処理技術協会　(依頼中含む)

日　程：平成26年9月2日（火）、3日（水）（分析展JASIS2014(主催：日本分析機器工業会）と共催）

会　場：幕張メッセ　国際会議室　（千葉市美浜区中瀬2-1）

参加費（予稿集含む）：会員及び協賛学会員(個人会員) 6,000円、　学生 無料

　　 非会員 11,000円(1年間の日本顕微鏡学会正会員が付与されます)

内　容：分析電顕討論会30周年を記念して内外の研究者を招へいし分析電顕の将来展望と最近進展が著しい検出器と計算技術をトピックスします。チュートリアルはEDS, EELS及びFIBに関する基礎と応用を分かり易く講義します。一般講演も募集していますので、奮ってご参加ください。

詳細につきましては http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/bunseki2014/ をご覧下さい。

申込方法：上記 Web Page よりお申込み下さい。または下記登録票を Fax にて御送付下さい。

連絡先：〒187-8588 東京都小平市上水本町5丁目20-1　ルネサスエレクトロニクス(株)解析評価技術部内

分析電子顕微鏡討論会事務局　（担当：朝山匡一郎）

Tel 042-312-7404 / Fax 042-327-8691 / E-mail: bunseki30@eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp

締　切：**一般講演申込締切 7月11日（金）、予稿締切 7月25日（金）、参加申込締切 8月18日（月）**

■当日の参加申込みも歓迎いたしますが、できるだけ事前登録にご協力下さい。

FAX 用参加登録票　(右下枠内にご記入下さい。送信後、当日 受付にお持ちください)

登録内容に変更のある場合には余白に適宜修正を加えてください。複数の方が参加される場合にはコピーしてお使い下さい。参加費は当日受付にて現金でお支払い頂くか、銀行振込みにてお願いします。

振込される方で請求書の必要な方は下記「請求書要」に✔を付けてください。請求書の宛名に記載する事項を選んでください。

ふりがな

参加者氏名: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿\_\_\_

E-mail:

参加費区分（該当箇所に✔を付けてください）

□一般　￥11,000－

□日本顕微鏡学会員　￥6,000－

□協賛学協会員　￥6,000－

(学協会名　　　　　　　　　　)

* 学生　無料
* 請求書要 (宛名：所属、氏名、両方)

FAX 送信先: 042-327-8691

または http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/bunseki2014/ より登録お願いします

第30回分析電子顕微鏡討論会　プログラム

（2014年5月30日現在）

最新のプログラムは http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/bunseki2014/ よりご確認下さい。

　9月2日(火) 10:00-17:00

1. チュートリアル (各40分)

10:00- EDSの仕組み～X線の発生から解析まで 山口 晋　　(ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ ㈱)

10:40- 電子エネルギー損失分光法(EELS)入門 木本 浩司　(物材機構)

11:20- FIBの基礎と応用 完山 正林　(日本FEI ㈱)

2.　特別講演「ｽｷﾙﾐｵﾝ-電子顕微鏡が見るｽﾋﾟﾝのつくるﾅﾉ粒子」 ( 60分)

13:30- 十倉　好紀　(東京大学/理研)

3. トピックス1 「シミュレーションと先端実験」 (各30分)

14:40- Bloch波によるSTEM像シミュレーション 渡辺 和人　(都立高専)

15:10- ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ法によるSTEM像のシミュレーション 石塚 和夫　(㈲ HREM)

15:40- EELSスペクトルの第一原理計算 溝口 照康　(東大生研)

16:10- 電子磁気円二色性に基づくナノ領域磁気角運動量定量測定　　武藤 俊介(名古屋大学)

　9月3日(水) 10:00-17:00

1. 30周年特別企画 (各40分)

10:00- 超高分解能を迎え撃つもの 市野瀬 英喜(理研)

10:40- EELS分析の現状と将来 倉田 博基　(京大化研)

11:20- The Future perspective of the aberration correction technology

Dr. Max. Haider (CEOS gmbh.)

2. トピックス２ 検出器とカメラの多様化　(各30分)

13:30- Nanoscale Optical analysis in the TEM Dr. Alan Maigne (GATAN Inc.)

14:00- 超分子構造解析におけるﾀﾞｲﾚｸﾄﾃﾞｨﾃｸﾀｰの効果　加藤　貴之(大阪大学)

14:30- 高検出効率、高立体角EDS検出器を用いた高精度ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ分析

山崎 厳　(ﾌﾞﾙｶｰ・ｴｲｴｯｸｽｴｽ ㈱)

15:00- 電子顕微鏡用軟X線分光器の開発と応用 高橋 秀之　(日本電子)

3. 一般講演 (各15分)　５件